ISSN 1001-4322

强激光与粒子束 2002年 第01期:

CN51-1311/04

高功率激光与光学

微电路pn结瞬态电离辐射响应二维数值模拟

 $\frac{1}{2}$ <u>张义门</u> <u>陈雨生</u> <u>周辉</u> <u></u> <u>廣世斌</u> <u>龚仁喜</u> <u>美颖</u> <u>韩福斌</u> <u>龚建成</u>

(1. 西安电子科技大学 徽电子研究所,陕西 西安 710071; 2. 西北核技术研究所,陕西 西安 710024)

摘要:用增强光电流模型对微电路pn结瞬态电离辐射响应开展了数值模拟计算。该模型在Wirth-Rogers光电流模型的基础上,增加考虑了高注入对过剩载流子寿命的影响以及衬底(准中性区)电场的效应,这些效应对于高阻材料是不容忽视的。该模型对正确预估微电路PN结瞬态电离辐射响应提供了很好的评估手段。

关键词: 微电路 增强光电流模型 Wirth-Rogers光电流模型 过剩少数载流子 高阻材料

通信作者:

相关文章(微电路):

微电路pn结瞬态电离辐射响应二维数值 模拟

[PDF全文]

[HTML摘要]

发表评论

查看评论